力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)

Y.LULIVED 2 2 JAN 2004 PCT WIPO

(佐第12年、仏間1780年) [PCT36条及びPCT規	見則70」					
出願人又は代理人 の書類記号 137323-875	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP02/09512	国際出願日 (日.月.年) 17.09.2002 (日.月.年) 27.12.2001					
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L21/205、H01L21/22、C23C16/458、C23C16/46、H01L21/68						
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社						
1 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。						
2 この国際予備審査報告は、この表						

東京工	- レクトロン株式会社
1.	国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。 この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。 区 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 2 ページである。
3.	この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I X 国際予備審査報告の基礎
	Ⅲ
	IV 発明の単一性の欠如 V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明の文献及び説明
	VI 」 ある種の引用文献 VII 国際出願の不備 VII 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日		
	備審査報告を作成した日 08.01.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁(I PEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番	審査官(権限のある職員) 一 一 加藤 浩一	3 4 2 5



国際出願番号 PCT/JP02/09512

国際予備審査報告						
I. 国際予備審査報告の基礎						
1.						
出願時の国際出願書類						
X 明細書 第 1-9 ページ、 明細書 第 ページ、 明細書 第 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの ————— 付の書簡と共に提出されたもの					
X	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 29.08.2003 付の書簡と共に提出されたもの					
X 図面 第 1-7 ページ/図、ページ/図、ページ/図、ページ/図、ページ/図。	、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの					
明細書の配列表の部分 第ページ、明細書の配列表の部分 第ページ、明細書の配列表の部分 第ページ、明細書の配列表の部分 第ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、こ	この国際出願の官語である。					
上記の書類は、下記の官語である 語でる						
国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)に10 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2 を 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含ん	たは55.3にいう翻訳文の言語					
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出						
があった。	による能力をに記録した。					
図面 図面の第	ページ/図					
5. 二 この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、 れるので、その補正がされなかったものとして作成 記1. における判断の際に考慮しなければならず、	補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 本報告に添付する。)					



国際出願番号 PCT/JP02/09512

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について 文献及び説明	Cの法第12条(PCT35条(2)) に定める見	l解、それを裏付ける
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 <u>1-13</u> 請求の範囲	有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 <u>1-13</u>	
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-13</u> 請求の範囲	
<u> </u>			

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 11-260746 A(住友金属工業株式会社)1999.09.24 文献2: WO 00/19502 A1(株式会社日立製作所)2000.04.06 文献3: JP 11-097362 A(富士通株式会社)1999.04.09

文献4:JP 2000-269150 A(東芝セラミックス株式会社)2000.09.29

文献5: JP 10-050626 A(三井造船株式会社)1998.02.20図 1 文献6: WO 01/18856 A1(三菱マテリアルシリコン株式会社)2001.03.15

文献7: JP 11-031639 A(国際電気株式会社)1999.02.02

文献8: JP 9-237781 A(東京エレクトロン株式会社)1997.09.09

請求の範囲1-13に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1(請求項2、請求項3、図1、図2)、文献2(請求項5、第7頁第6-7行、FIG4)と、文献3(請求項1、図1)、文献5(図1)とにより進歩性を有しない。文献1、2では、支持板は「ウェーハ挿入溝」、「溝」を介して支柱に取り付けられるが、これを文献3のように「支持爪」を介して取り付けることは、当業者が適宜なし得たことである。一方、「支持爪」の側壁部に当接して滑落を防止する係止構造は、文献5の図1に記載されているとうに関知である。 1に記載されているように周知である。従って、文献1、2により教示された支持板に、滑落を防止する係止部を設けることは当業者にとって容易である。

被処理体搭載面に、被処理体の張り付きを抑制するための微細な凹凸を設けることは周知(文献4の請求項4、【0021】、【0033】)の構成である。

部材に係止部あるいは係合孔を設けることは慣用(文献5の図1、文献6の図1、 新たに引用する文献8の請求項3)されており、この点に進歩性は認められない。

熱処理用ボートの上端部及び下端部に複数のダミープレートを取り付けるこ とは周知(文献7の請求項1、図1)の構成にすぎない。

請求の範囲

複数の支柱と、 (補正後)

前記支柱の各々において、高さ方向に所定の間隔で形成された複数の爪部と、 前記爪部を介して前記複数の支柱間に多段に取り付けられた、被処理体を搭載 可能な被処理体搭載面を有する複数の支持板と、

前記被処理体搭載面に設けられた溝及び貫通孔と、 を備え、

前記複数の支柱は、少なくとも前記支持板の左方及び右方に配置されており、 前記支持板には、前記支持板の左方の支柱の爪部に係止されて当該支持板の滑 落を防止する左係止部と、前記支持板の右方の支柱の爪部に係止されて当該支持 板の滑落を防止する右係止部と、が設けられている ことを特徴とする熱処理用ボート。

- 前記被処理体搭載面には、被処理体の張り付きを抑制するた (補正後) 2. めの微細な凹凸が設けられている
- ことを特徴とする請求項1に記載の熱処理用ボート。
 - 前記支持板は略円形であり、 3.

前記複数の支柱は、前記支持板に垂直に、前記支持板の後方、左方及び右方に 配置されている

- ことを特徴とする請求項1または2に記載の熱処理用ボート。
 - 前記支持板は略円形であり、 (補正後)

前記溝は、同心円状に設けられた複数の環状の溝であり、

前記貫通孔は、各環状構内において当該環状構の周方向に所定の間隔で複数設 けられた貫通孔である

ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の熱処理用ボート。

10/1

5. (補正後) 前記左係止部及び前記右係止部は、爪部の側壁部に当接する ストッパ部材である

ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の熱処理用ボート。